

Зміст

Вступ	7
1 Вузлові моменти розвитку теорії дифракції	9
2 Методи аналізу оптичної дифракції	13
2.1. МЗХ та його зв'язок з МЗМ	14
2.2. Отримання систем рівнянь МЗХ методом збурення	19
2.3. Отримання методом збурень точних систем рівнянь МЗХ	21
2.3.1. Модифікація та узагальнення систем рівнянь	28
2.3.2. Прямий алгоритм аналізу дифракції	29
2.3.3. Параболічне наближення для товстих фазових ґраток	31
2.4. МЗХ для планарних та рельєфних ґраток	33
2.4.1. Рівняння опису дифракції електромагнітних хвиль ТЕ поляризації	34
2.4.2. Система рівнянь, яка описує дифракцію хвиль ТМ поляризації	35
2.4.3. Розв'язання систем диференціальних рівнянь у матричній формі	36
3 Числові алгоритми аналізу дифракції	37
3.1. Прямий числовий Т-алгоритм аналізу дифракції	37
3.2. Модифікований стійкий числовий S-алгоритм	40
3.3. Модифікований стійкий числовий R-алгоритм	42
3.4. Симетризація системи диференціальних рівнянь у МЗХ	43
3.4.1. Числовий аналіз МЗХ за наявності симетрії	46
3.5. Точність аналізу МЗХ оптичної дифракції на ґратках	50
3.5.1. Точність аналізу МЗХ оптичної дифракції на прямокутних металевих ґратках	51
3.5.2. Точність аналізу МЗХ оптичної дифракції на прямокутній діелектричній ґратці	55
3.5.3. Точність аналізу МЗХ оптичної дифракції на діелектричних ґратках з косинусоїдальною зміню діелектричної проникності	56
3.6. Порівняння МЗХ з наближеними методами аналізу ґраток	57
3.6.1. Дифракційна ефективність тонкої фазової ґратки	59

3.6.2.	Моделювання ефекту Тальбота МЗХ	63
3.7.	Деякі застосування планарних ґраток	66
3.7.1.	Поляризатор на основі періодично розміщених нанопровідників	66
3.7.2.	Просвітлення ґраткою границі прозорий діелектрик-повітря	68
3.7.3.	Спектральні особливості структури “діелектрична ґратка на діелектричній підкладці”	74
4	Аналіз фазових ґраток	77
4.1.	Класифікація фазових голограм за товщиною	79
4.2.	Числовий аналіз фазових голограм малої та проміжної товщин	82
4.3.	Двохвильове наближення для товстих об’ємних ґраток	85
4.3.1.	Двохвильове наближення для товстих фазових ґраток	85
4.3.2.	Двохвильове наближення для товстих амплітудно-фазових ґраток	88
4.4.	Нелінійність запису голограм	91
4.4.1.	Аналітичний зв’язок між n_{1ef} і n_{2ef} з n_1 і n_2 для першого і другого кутів Бреґга	94
4.4.2.	Аналітичний зв’язок між n_{1ef} , n_{2ef} і n_{3ef} з n_1 , n_2 і n_3 для трьох перших кутів Бреґга	100
4.4.3.	Умови застосування ефективних значень модуляції показника заломлення	103
4.4.4.	Числовий розрахунок дифракційної ефективності товстих фазових голограм з урахуванням n_1 , n_2 і n_3	104
4.4.5.	Розрахунок n_1 , n_2 , і n_3 за експериментальними залежностями дифракційної ефективності від кута падіння пучка на ґратку	106
4.5.	Багатошарові голограми	110
4.5.1.	Дифракційна ефективність багатошарових голограм	111
4.5.2.	Оптичні властивості багатошарових голограм	114
4.5.3.	Можливі варіанти виготовлення багатошарових голограм	118
5	Аналіз багатошарових структур	123
5.1.	Матричний метод аналізу багатошарових структур	124
5.2.	Аналіз відбивання від ґратки МРПРФ	125
5.3.	Межові умови для багатошарових структур	127
5.4.	Розв’язок систем рівнянь	129
5.5.	Аналіз структур, для яких ε_2 змінюється довільно	131
5.6.	Наближені методи аналізу суто відбивних ґраток	135
5.6.1.	Взаємодія оптичних хвиль із суто відбивною ґраткою у разі виконання умов Бреґга першого порядку	136
5.6.2.	Взаємодія оптичних хвиль із суто відбивною ґраткою у разі виконання умов Бреґга другого порядку	147

5.6.3.	Взаємодія оптичних хвиль із суто відбивною ґраткою у разі виконання умов Бреґґа другого порядку за нелінійності запису ґратки	158
5.6.4.	Взаємодія оптичних хвиль із суто відбивною ґраткою у разі виконання умов Бреґґа третього порядку	164
5.6.5.	Взаємодія оптичних хвиль із суто відбивною ґраткою у разі виконання умов Бреґґа третього порядку за наявності нелінійності	170
5.6.6.	Обґрунтування нехтування першою похідною від $t_j(z)$ і $r_j(z)$, коли $j \neq 0$	177
6	Можливі застосування багат шарових структур	179
6.1.	Структура “шар діелектрика–металева плівка–шар діелектрика”	179
6.2.	Структура “шар діелектрика–інтерференційне дзеркало–шар діелектрика”	186
6.3.	Просвітлення перехідним діелектричним шаром	193
6.4.	Резонансні явища в призмових структурах з металевою плівкою	195
6.4.1.	Особливості кутових залежностей коефіцієнта відбивання	196
6.4.2.	Чутливість зміщення мінімуму коефіцієнта відбивання до зміни показника заломлення n_s	198
6.4.3.	Чутливість коефіцієнта відбивання від металевої плівки до зміни показника заломлення n_s	200
7	Фотонні кристали	203
7.1.	Метод плоских хвиль аналізу 2D фотонних кристалів	206
7.2.	Аналіз зонної структури 1D і 2D фотонних кристалів	208
7.2.1.	1D фотонний кристал	209
7.2.2.	2D фотонний кристал	213
7.2.3.	Побудова зонної структури 2D фотонного кристала	217
8	Резонансне поглинання в ґратках з металевими складовими	226
8.1.	Особливості планарних хвилеводів з металевими складовими	227
8.1.1.	Хвилевід: метал–діелектрик–метал	228
8.1.2.	Хвилевід: діелектрик–тонка плівка металу–діелектрик	230
8.1.3.	Хвилевід: метал–тонка плівка діелектрика–діелектрик	234
8.1.4.	Хвилевід: діелектрик–шар діелектрика–тонка плівка металу–шар діелектрика–діелектрик	236
8.2.	Поглинання системою “діелектрична ґратка на металі”	236
8.2.1.	Визначення наближених параметрів ґратки повного поглинання на основі хвилеводного ефекту	237
8.2.2.	Повне поглинання системою “ґратка на металевій підкладці”	239
8.3.	Діелектричний хвилевід–металева ґратка–металева підкладка	242
8.3.1.	Повне поглинання електромагнітних хвиль у структурі діелектрична плівка–металева ґратка	243

8.3.2.	Поглинання електромагнітних хвиль у металевій гратці з прямокутним рельєфом ($d_1 = 0$)	244
8.3.3.	Резонансно-хвильоводні явища в щілині ґратки	246
8.4.	Збудження ґраткою поверхневих плазмон-поляритонів	249
9	Пропускання ґраток з металевими складовими	258
9.1.	Структура: металева плівка між двома діелектричними ґратками	258
9.2.	Пропускання металевих ґраток з вузькими щілинами	263
9.3.	ґратка між двома діелектричними шарами	269
9.4.	Металева плівка між двома тонкими ґратками	272
	Список літератури	278